

液中レーザープロセス技術の展開

日時： 3月20日（日）

13:15 ~ 18:45

会場： 西3号館W321室

企画趣旨

レーザープロセス技術は、有機材料、無機材料を問わず幅広い材料に適用できることから新材料製造開発の基盤技術として広く活用されています。光の空間伝播性によってプロセス環境を自由に選択できるのがレーザープロセス技術の1つの利点であり、レーザープロセス技術の新たな展開として液体中でのレーザープロセス技術が進展してきました。レーザープロセス技術の観点のみならず、材料・化学の観点等、分野横断的に技術を俯瞰し、更なる技術の展開の可能性を議論するために本シンポジウムを企画しました。

招待講演

液中レーザープロセスの研究展開 —物理プロセスと化学プロセスの融合—

越崎直人（北海道大学）

高速度レーザーstroボビデオ撮影による液中レーザーアブレーションの可視化観察

伊藤義郎（長岡技術科学大学）

溶液中への高強度レーザー照射による金属・合金ナノ粒子合成とその特性

中村貴宏（東北大学）

レーザープロセスによるナノ粒子生成と光電デバイスへの活用

齋藤健一（広島大学）

多孔質Siの液中レーザー照射によるナノ結晶Si粒子の高効率生成と発光色制御

中村俊博（群馬大学）

気・液界面レーザーアブレーションによるサブナノ、シングルナノクラスター創製

西 哲平（豊田中研）

フェムト秒レーザー誘起プラズマによる液体からの親水性炭素ナノ粒子の生成

八ツ橋知幸（大阪市立大学）

他、一般講演6件